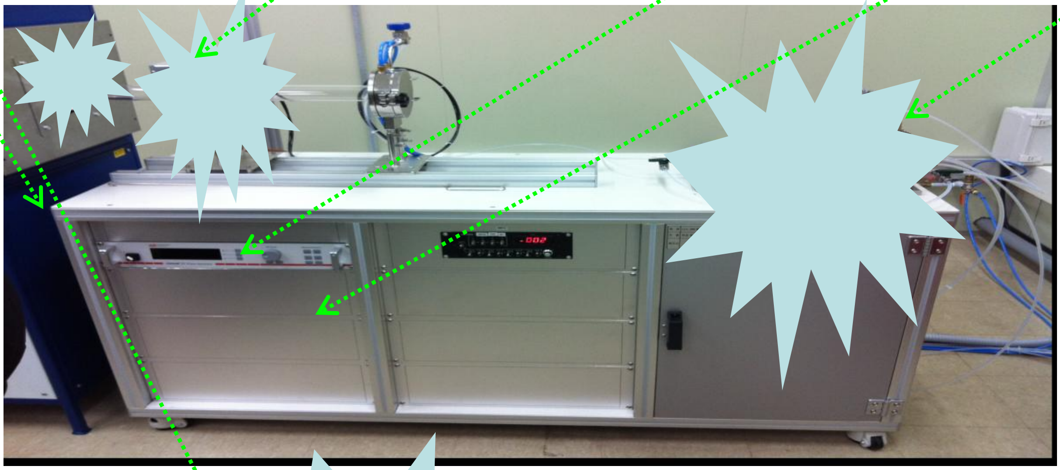
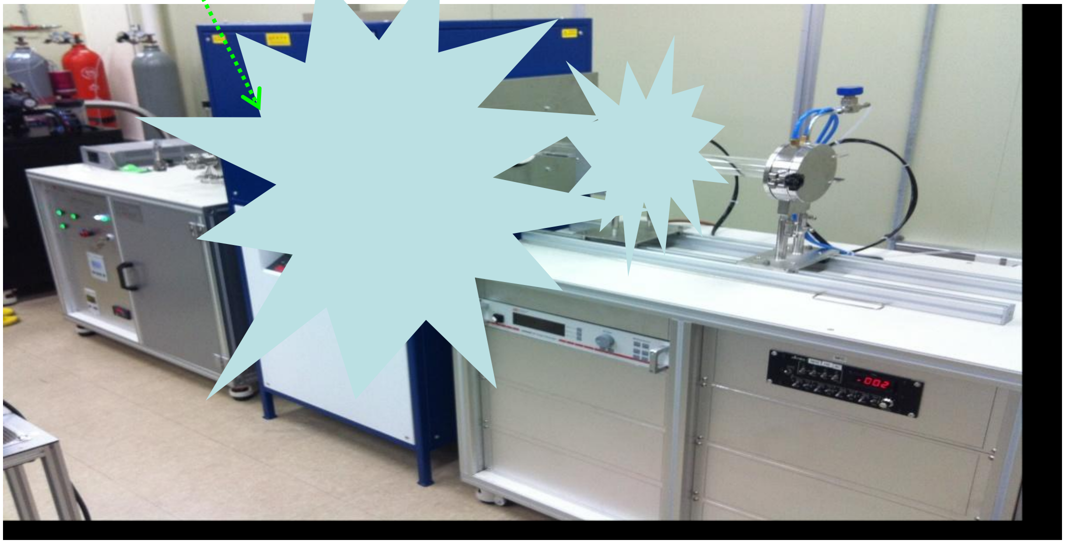
Tel: 042-933-2514
Fax: 042-934-2515
http://www.allfs.com
allforsystem@gmail.com

Furnace에 Graphene 연구를 위한 ICP Source 설치한 장비
즉, Thermal CVD에 Plasma를 적용한 장비임

Furnace ICP Source Module : 고밀도 Plasma 발생 RF Power RF Matcher(내부) MFC





Turbo-pump 내부 및 Vacuum Line 설치 됨:
Graphene 연구시 국내에서 Plasma를 활용하면 고진공 Pump를 적용하고 있음

Vacuum Gauge, Vacuum Gauge Controller, MFC Controller, 등이 필요하고
장비에 연결되는 Utility Line이 별도로 필요함